

**Bibliographic  
data**

Description

Claims

[Mosaics](#)[Original  
document](#)[INPADOC  
legal status](#)

Publication number: JP2001358055

Publication date: 2001-12-26

Inventor: OKUMURA MASAHIKO

Applicant: NIPPON KOGAKU KK

Classification:

- international: *G03F7/20; H01L21/027; G03F7/20; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/027; G03F7/20*

- European: G03F7/20T16; G03F7/20T24

Application number: JP20000179549 20000615

Priority number(s): JP20000179549 20000615

[View INPADOC patent family](#)

[View list of citing documents](#)

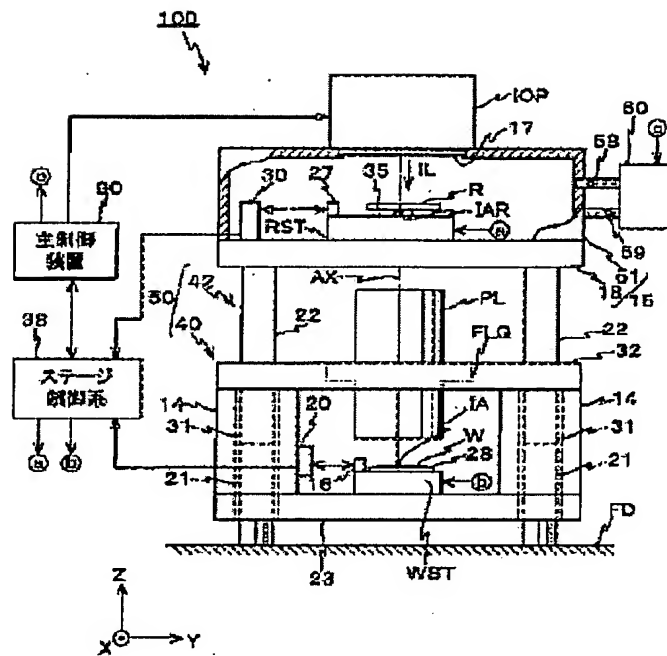
[Report a data error here](#)

Abstract of **JP2001358055**

**PROBLEM TO BE SOLVED:**

To provide an exposure apparatus for contributing to further improvement in throughput.

**SOLUTION:** A reticle stage RST has an electrostatic chuck 35 for attracting reticles R. A chamber 15 for containing the stage RST is provided, and humidity of an atmosphere in the chamber 15 is regulated to a predetermined value or less by a humidity regulator 60. Thus, even when the stage RST is driven at a high acceleration, the reticles R can be stably held by an attracting force of the chuck. When reduction projecting exposure is conducted by a scanning exposure system, large acceleration is required for the stage RST, and hence the stage RST at a scanning exposure time and a wafer stage WST can be highly accelerated at its speed, and the throughput can be improved by shortening the scanning exposure time.



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2001-358055  
(P2001-358055A)

(43) 公開日 平成13年12月26日 (2001. 12. 26)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコード(参考)
H 0 1 L 21/027		C 0 3 F 7/20	S 2 1 5 F 0 4 6
G 0 3 F 7/20	5 2 1	H 0 1 L 21/30	S 1 6 F
			S 0 3 A
			S 1 8

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 17 頁)

(21) 出願番号 特願2000-179549(P2000-179549)  
(22) 出願日 平成12年6月15日(2000. 6. 15)

(71) 出願人 000004112  
株式会社ニコン  
東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  
(72) 発明者 奥村 正彦  
東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株  
式会社ニコン内  
(74) 代理人 100102901  
弁理士 立石 篤司  
Fターム(参考) 5F046 AA22 BA05 CC01 CC02 CC08  
CC09 DA27 DB03

(54) 【発明の名称】 露光装置及びデバイス製造方法

(57) 【要約】

【課題】 スループットの更なる向上に寄与する露光装置を提供する。

【解決手段】 レチクルステージRSTが、レチクルRを吸着する静電チャック35を有している。また、レチクルステージRSTを収納するチャンバ15が設けられ、該チャンバ15内部の雰囲気湿度が湿度調整装置60により所定値以下に調整されている。このため、レチクルステージRSTを高加速度で駆動するときにも、静電チャックの吸着力によりレチクルRを安定して保持することができる。走査露光方式により縮小投影露光を行う場合は、レチクルステージRSTに大きな加速度が要求されるので、走査露光時のレチクルステージRSTとウエハステージWSTの高加速度化、高速化が可能となり、走査露光時間の短縮によりスループットの向上が可能である。

